

最先端の半導体ウェットプロセスは、ナノレベルでの気液固体の相互作用によって制御されます。この界面現象を把握するには、電子化学的な解明が必要であり、このシンポジウムでは、バイオサイエンス等の異なる分野の研究者や技術者と議論し、新たな半導体ウェットプロセス技術の創出につなげます。

9/18(水)
13:30~
開催

異分野に広がる界面ナノ電子化学 ～最先端半導体からバイオサイエンスまで～

日時：2024年9月18日（水） 13：30～17：00

場所：ホテル日航新潟 会場C4 1

13:30 洗浄乾燥時の微細構造倒壊メカニズム（招待講演）

小出 辰彦（キオクシア）

14:00 表面極近傍に移動するナノ粒子の三次元挙動観測（招待講演）

カチョーンルンルアン パナート（九州工業大学）

14:30 枚葉スピン式洗浄のリンス処理における薬液排出過程の三次元数値計算

神保 佳典（静岡大学）

15:00 多彩な液体と気体のインタラクションで見るバイオ界面（招待講演）

田中 信行（理化学研究所）

15:30 nmサイズの狭所内SiO₂ エッチングにおけるシリコンの疎水性及び表面電位の効果
（招待講演・INF第8回ポスター展優秀講演賞記念講演）

宮川 彰平（SCREENホールディングス）

16:00 FM-AFMによるナノスコピックなぬれのその場観察（招待講演）

荒木 優希（金沢大）

16:30 純水噴霧の誘導帯電メカニズムの解析

渡部 一哲（愛知工業大学）

16:45 二流体スプレー時の飛行液滴の電荷特性とSiO₂ウェハの表面電位の関係性

伊藤 康生（愛知工業大学）

界面ナノ電子化学研究会

シンポジウム世話人：清家善之（愛知工大） 吉水康人（キオクシア） 新井豊子（金沢大） 小川義宏（キオクシア）

連絡先：y_seike@aitech.ac.jp